

# TRUQ 法 Nb<sub>3</sub>Al 線材の微視的組織と超伝導特性

Microstructure and Superconducting properties of TRUQ Nb<sub>3</sub>Al superconductors

NIMS<sup>A</sup>, UW-Madison<sup>B</sup>

伴野信哉<sup>A</sup>, 竹内孝夫<sup>A</sup>, 二森茂樹<sup>A</sup>, 菊池章弘<sup>A</sup>, 飯島安男<sup>A</sup>, Peter J. Lee<sup>B</sup>, 福崎智数<sup>A</sup>, 辰巳憲之<sup>A</sup>, 井上廉<sup>A</sup>, 湯山道也<sup>A</sup>, 和田仁<sup>A</sup>  
N. Banno, T. Takeuchi, S. Nimori, A. Kikuchi, Y. Iijima, Peter J. Lee, T. Fukuzaki, N. Tatsumi, K. Inoue, M. Yuyama, H. Wada

National Institute for Materials Science<sup>A</sup>

University of Wisconsin Madison<sup>B</sup>

E-mail: BANNO.Nobuya@nims.go.jp

## 1. はじめに

従来の変態法 (いわゆる RHQT 法) Nb<sub>3</sub>Al 線材では, 変態後の A15 結晶粒内に多数の積層欠陥が観測され, それらが, 化学量論組成の Nb<sub>3</sub>Al が本来有する T<sub>c</sub> や B<sub>c2</sub> を低下させていると考えられている. 我々は最近, 高速な昇温と高温変態とを組み合わせ, それら積層欠陥を抑制し, 高磁界特性を大幅に改善させた新しい変態法, TRUQ 法を開発した. TRUQ 法はコイル形状にも適用できる可能性があり, 実用的にも興味深い変態法であるが, その特性の向上の要因については明確になっていない. そこで今回, 透過電子顕微鏡(TEM)により, TRUQ 法 Nb<sub>3</sub>Al 線材における超伝導相の微視的組織を観察し, 加えてピンニング特性を調べた.

## 2. 実験方法

TEM 観察試料として, 線径 0.98mm (急冷後の断面減少率 40%, 銅被服なし), Nb 比 0.59 の線材を 1000 1min で TRUQ 処理し, その後 A15 相の規則化のために 750 50h の後熱処理を施した. 試料の T<sub>c</sub> は 18.3K と従来変態法 (17.8K) と比べ非常に高く, TRUQ 処理は良好に行われていると考えられる. 観察試料は集束イオンビーム (FIB) 加工装置により作製した.

ピンニング特性を調べるための試料には, Cu-clad 線材 (1.81mm<sup>2</sup>×0.8mm<sup>2</sup>, Cu/non-Cu 比 0.39, Nb/SC 比 0.81) を用い, 1000 5min で TRUQ 処理後, 800 10h で追加熱処理した. 試料を VTI に挿入して J<sub>c</sub> の温度特性を測定し, ピンニング特性を求めた. 試料温度は cernox センサ (SD タイプ) を試料の直上に設置してモニタした. 比較データとして, 加工なしの従来 RHQT 線材のピンニング特性も示した.

## 3. 結果

Fig. 1 に TRUQ 試料における A15 相の TEM 像を示す. RHQT 線材と同様に, A15 相は小傾角粒界で区切られたサブ結晶で構成されており, また A15 相の粒界はなめらかである. 依然として粒内には Al 濃度に富んだ積層欠陥が観察されるが, その間隔は従来 RHQT 試料の間隔 (約 20 $\mu$ m) に比べ広いように見え, このことが化学量論組成の改善をもたらす H<sub>c2</sub> の向上に寄与していると考えられる.

Fig. 2 (a), (b) に TRUQ 及び RHQT 線材におけるピンニング特性の温度依存性を示す. 横軸はともに, クレマープロットにより求めた B<sub>c2</sub><sup>\*</sup> で規格化した. RHQT 線材がほぼ同一のスケール則に乗るのに対し, TRUQ 線材では, 低温ほど F<sub>p</sub> のピーク位置が高磁界側へシフトする傾向を示した. 掃引速度を速くし, 試料の温度上昇を極力避けては

いるものの, 通電電流が増加したときに, 発熱により低磁界側で特性が寝た可能性もある. 今後, 磁化特性と合わせて検討を進めていく.

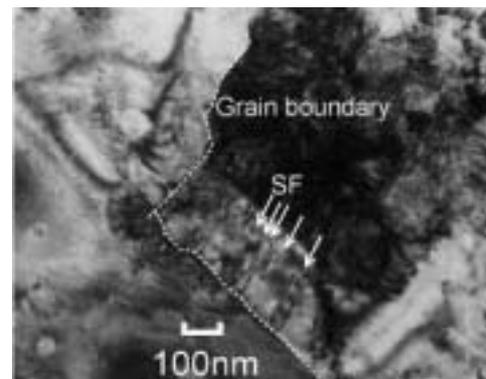
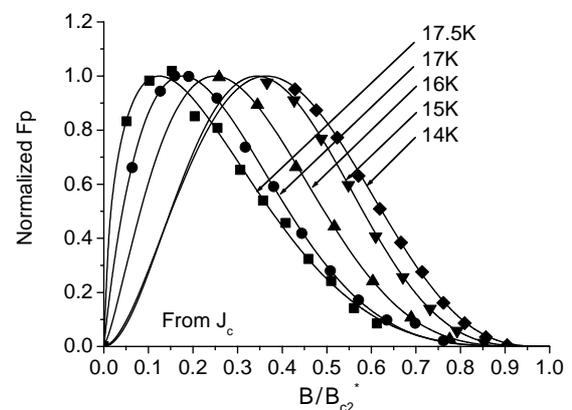
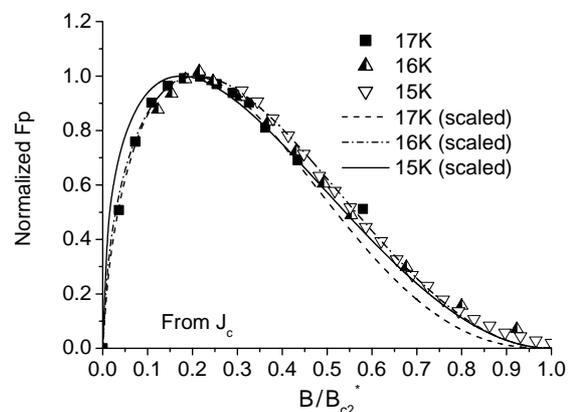


Fig. 1. TEM microstructure of Nb<sub>3</sub>Al phase of TRUQ sample.



(a) TRUQ sample (Cu-clad)



(b) Ordinary RHQT (bare and non-deformed)

Fig. 2. Normalized F<sub>p</sub> characteristics.